# Optoelectronic Devices(光电子器件)

检测光子和释放光子的电子器件

Photoconductors:会因为光照改变导电性的材料

# Photodiodes(光二极管)

吸收一个能量大于 $E_g$ 的光子,就能产生一对空穴-电子对,由于内建电场的作用,电子流向 n 区,空穴流向 p 区,反向偏置能加速这个过程,增大光电流

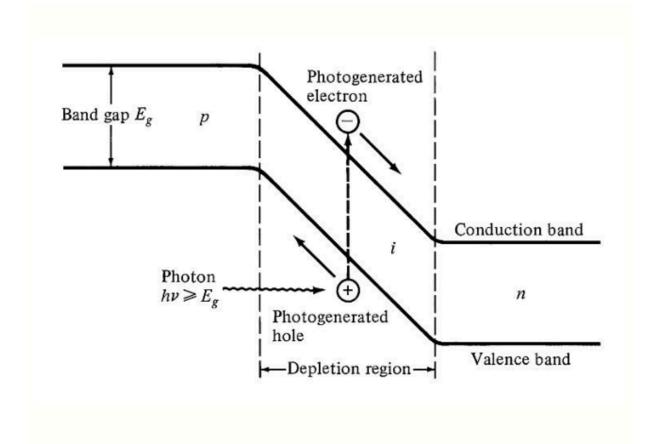


Figure 1: 吸收能量大于 $E_q$ 的光子

光电流大小

$$I_{\rm op} = qAg_{{\rm op}(L_p + L_n + W)}$$
 [1]

 $g_{
m op}$ :optical generation rate A:P-N 结截面积  $L_p$ :空穴 diffusion 长度

 $L_n$ :电子 diffusion 长度 W:耗尽区宽度

总体电流(反向偏置)

$$I = I_{\rm th} \left( e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right) - I_{\rm op} \tag{2}$$

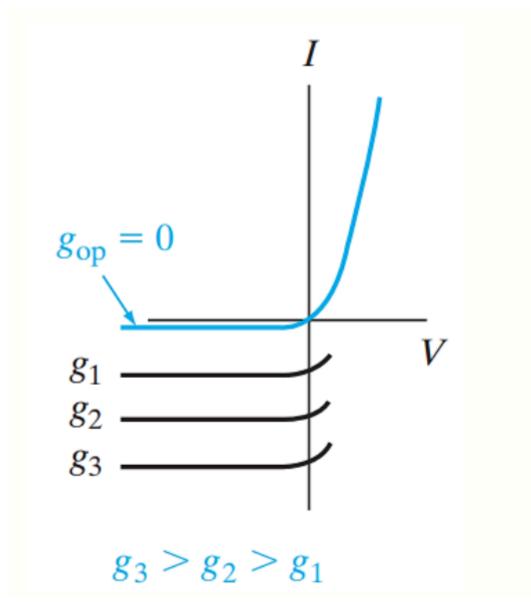


Figure 2: 光电流影响下的反向偏置

短路:
$$V=0,I=-I_{\mathrm{op}}$$
 短路: $I=0$ ,用公式可以推出 $V_{\mathrm{oc}}=\frac{kT}{q}\ln\left[\frac{I_{\mathrm{op}}}{I_{\mathrm{th}}}+1\right]$ 

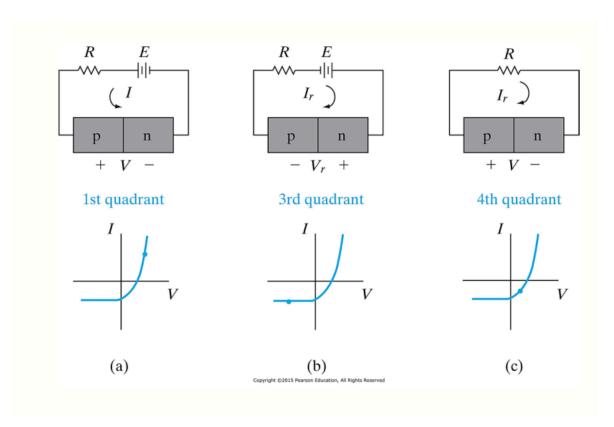


Figure 3: 不同情况下的工作点

注意第三个图, 自驱动的话虽然有光电压, 但电流和内建电场方向一致. 耗尽层增大, 能产生更大的光电流(灵敏度增大), 但是呢由于漂移时间长, 导致响应时间变长, 所以实际耗尽层厚度选择是采用的折中的方案, 所以一般是要建立一个 p-i-n 光二极管对耗尽层宽度进行控制.

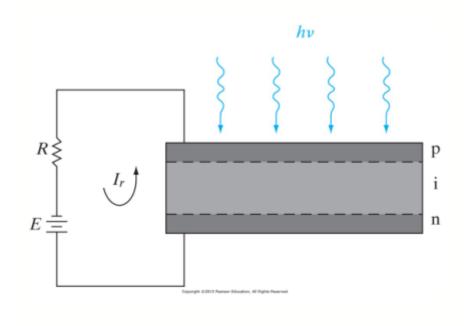


Figure 4: p-i-n 光二极管,i 极宽度约等于是耗尽层宽度,黑暗下电流小, 能侦测的波长范围更大

### Avalanche Photodiode(雪崩光二极管)

• 具有很高的灵敏度(很大的光电流)

Responsivity(用于衡量光二极管的效能)

$$R = \frac{I_{\rm op}}{P}(A/W) \tag{3}$$

 $I_{\rm op}$ :光电流

P:光照的功率

实际上 Equation 3 是定义式,实际上这个值是由波长等因素决定的,

$$R = \eta \frac{q}{hf} = \eta \frac{\lambda_{\mu m}}{1.23985} \tag{4}$$

 $\eta$ :是量子效率(quantum efficiency). h是普朗克常数

#### Responsivity (Typical Photodetector Characteristic)

Photodetector	Wavelength (nm)	Responsivity (A/W)
Silicon PN	550-850	0.41-0.7
Silicon PIN	850-950	0.6-0.8
InGaAs PIN	1310-1550	0.85
InGaAs APD	1310-1550	0.80
Germanium	1000-1500	0.70

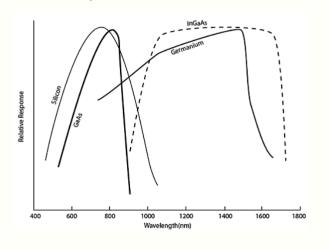


Figure 5: 不同材料对特定的波长响应比较好

$$\eta = \frac{\dot{\rho}$$
生的电子-空穴对的数量 吸收的光子数量 [5]

### 无光照电流(dark current)

- · 增加反偏电压,能增加 dark current
- Si 的 dark current 比 Ge 的小

### 工作区(只有两种选择)

A photodiode can be operated in one of two modes:

- Photoconductive (reverse bias)
- · Photovoltaic (zero-bias).

Mode selection depends upon the application's speed requirements and the amount of tolerable dark current (leakage current).

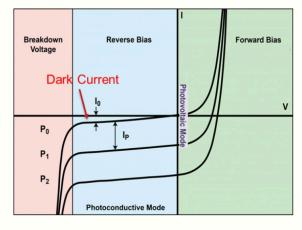


Figure 6: 光二极管的工作区

- Photoconductive(反偏), 电流和光照功率线性相关
- Photovoltaic(零偏置), 有最小的 dark current

# LED(Light-Emitting Diode) 发光二极管

## 发光原理

LED 是由直接带隙晶体管组成, 在 p-n 结的交界处, 电子和空穴复合, 释放出能量, 以光子的形式发射出来, 这种过程称为辐射复合( $E_g = hv$ )

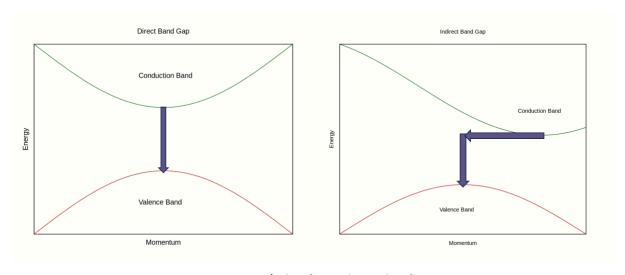


Figure 7: 直接带隙与间接带隙

- Efficiency
- Color Variation
- Longevity
- Instant On/Off
- Directionality
- Compact Size
- Environmental Benefits
- High Reliability

Figure 8: LED 的优点

### 类型

- Standard Visible LEDs:发出可见光的
- Infrared (IR) LEDs:发出红外线(例如遥控器,夜视仪)
- High-Power LED:发出光的能量特别高,例如航空照明
- RGB LEDs:包括 RBG 三种灯,用于显示各种颜色,例如 LED 屏

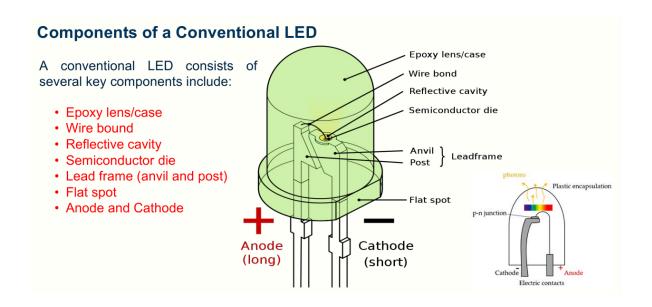


Figure 9: LED 的组成,包括半导体芯片,内反射腔...

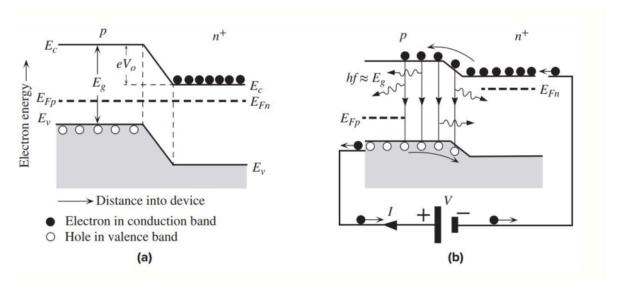


Figure 10: 没有加偏置的时候,P 和 N 区的费米能级是一样大的, 加上了偏置之后,  $E_{\rm Fn}-E_{\rm Fp}=eV$  (偏置电压)

LED 的发光方式是 Electroluminescence(由于少数载流子注入导致复合).

• spontaneous photon emission(自发光子发射):由于电子和空穴之间复合过程的统计性质,发射的光子是随机方向的;它们是由电子和空穴之间的自发复合过程产生的。

## 依据材料分类

- Homojuction (同质结) 质结是由同一种半导体材料构成的 p-n 结,尽管 p 区和 n 区的掺杂浓度不同,但两边的材料具有相同的能带结构(即相同的带隙能量  $E_g$ ),复合,产生光的效率低.
- Heterojunction(异质结): 异质结是由两种不同带隙的半导体材料构成的结区域。例如, GaAs 和 AlGaAs 是常见的组合。
- Double-Heterostructure (DH, 双异质结构)

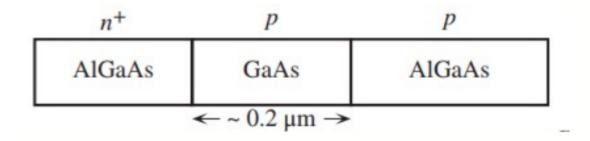


Figure 11: DH, 双异质结构

## Quantum Well High Intensity LEDs(量子阱高强度 led)

#### 1. 量子阱的基本结构

- 定义: 量子阱是由一个窄带隙半导体材料(例如GaAs,带隙  $E_{g1}$ )夹在两个宽带隙半导体材料(例如AlGaAs,带隙  $E_{g2}$ )之间形成的超薄层。
- 尺寸: 量子阱层的厚度通常非常薄 (小于50 nm) ,接近电子的德布罗意波长。
- 功能: 宽带隙材料充当限制层 (Confining Layers) , 将电子和空穴限制在中间的窄带隙材料内,从而实现更高效的载流子复合和光子发射。

#### 2. 量子化能级

#### 量子化现象:

- 在极薄的量子阱层中, 电子的运动被限制在一个方向 (通常是x方向)。
- 由于这种限制,电子的能级不再是连续的,而是离散的,形成量子化的能级(例如  $E_1,E_2,E_3)$  。
- 类似地,空穴也会形成量子化能级(例如  $E_1^\prime, E_2^\prime$ )。

#### • 电子和空穴复合:

- 带电荷的电子和空穴在最低能级 (例如  $E_1$  和  $E_1^\prime$ ) 复合,释放光子。
- 光子的能量  $h\nu$  等于量子阱材料的能( $\downarrow$ )  $E_1-E_1'$ 。

Figure 12: 改成最接近的两个能级处复合

通过改变量子阱的厚度和材料组成,LED的波长可以改变.

### 发光材料

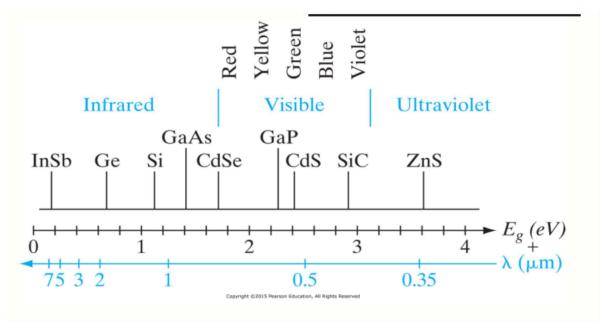


Figure 13: 材料和波长

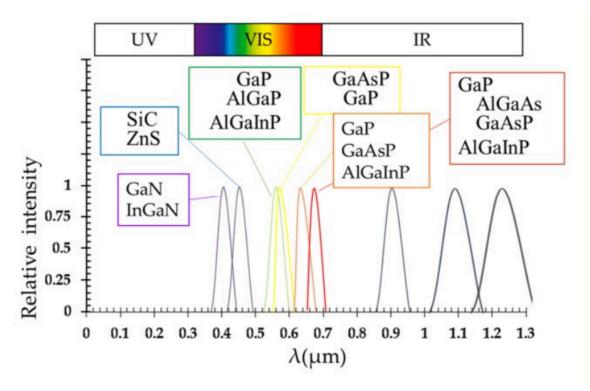


Figure 14: 材料的发射光谱,平均波长越小的材料,越窄要获得可见光,带隙要大于1.8eV(基本公式: $E_g=hv=h\frac{c}{\lambda}$ )

## Quantum Efficiency(量子效率)

$$\eta_{\text{EQE}}(\text{外部量子效率}) = \eta_{\text{IQE}}(\text{内部量子效率})\eta_{\text{EXT}}(萃取效率)$$
 [6]

$$\eta_{\text{IQE}} = \frac{\begin{subarray}{c} \begin{subarray}{c} \begin{$$

$$\eta_{\text{EXT}} = \frac{\dot{\text{单位时间内进入外部自由空间的光子数目}}}{\dot{\text{激发区域单位时间发出的光子数目}}}$$
 [8]

## Light Escape Cone in LED(避光锥)

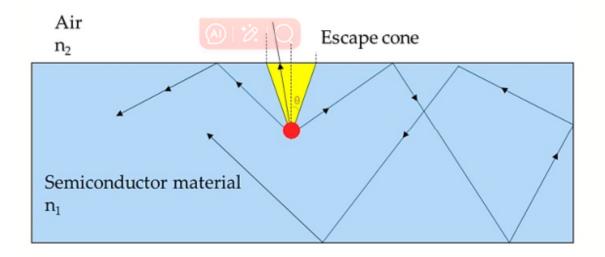
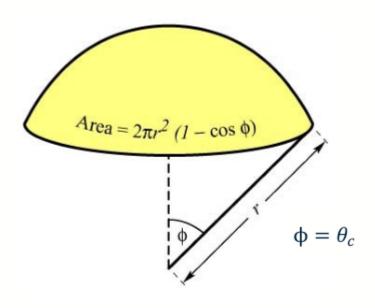


Figure 15: 入射角必须少于避光准的角度,才能避免全反射,有机会折射 入外部

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \tag{9}$$



$${\rm Area} = 2\pi^2(1-\cos\theta_c) \eqno{[10]}$$

可以逃逸的比例,用表面积计算: = 
$$\frac{2\pi^2(1-\cos\theta_c)}{4\pi r^2}$$
 =  $\frac{1}{2}(1-\cos\theta_c)$ 1]

由于半导体材料的反射率大, 能逃逸的比例很小, 一半会加一个n=1.5的塑料封装.

## **Solar Cells**

大多数太阳能电池使用晶体硅,因为硅基半导体制造现在是一种成熟的技术,可以制造出具有成本效益的设备。(效率 18%:多晶硅,22-24%:单晶硅),都是 homojunctions.

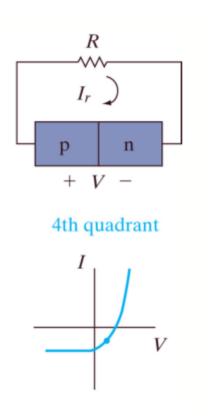


Figure 16: 就是再这种情况下才能把光能转换为电能

发电原理

n 区是狭窄而且重参杂的, guang

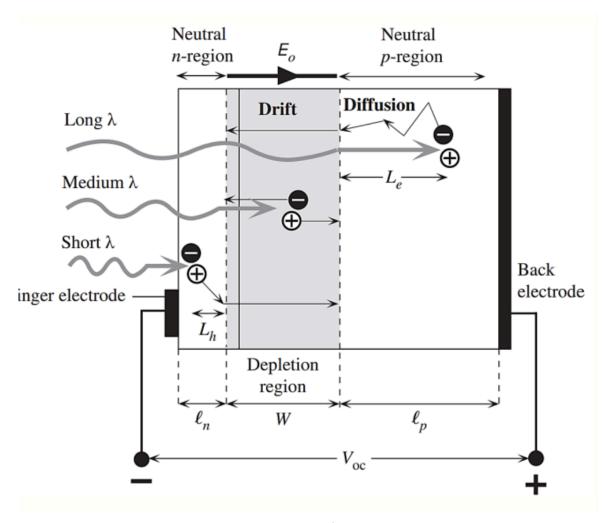


Figure 17: 发电原理

- 当光线 (太阳光) 照射到太阳能电池时,不同波长的光会穿透不同深度:
  - 短波长光 (短入): 在靠近n区表面被吸收,产生电子-空穴对。
  - **中波长光 (中λ)** : 在p-n结附近被吸收。
  - 长波长光 (长λ): 可以深入p区,被吸收后产生载流子。
- 被光子吸收后,半导体内的电子从价带跃迁到导带,留下一个空穴,形成电子-空穴对。

## Figure 18: 发电原理

由于n侧非常窄,大部分光子在耗尽区和p区被吸收,再耗尽区产生的电子-空穴对立即被内建电场分离,

### 电极设计

连接到 n 侧的电极必须允许照明进入器件, 同时具有小的电阻, 一般采用指状电极设计, 它们排列成细长条状, 并覆盖 n 区的表面。

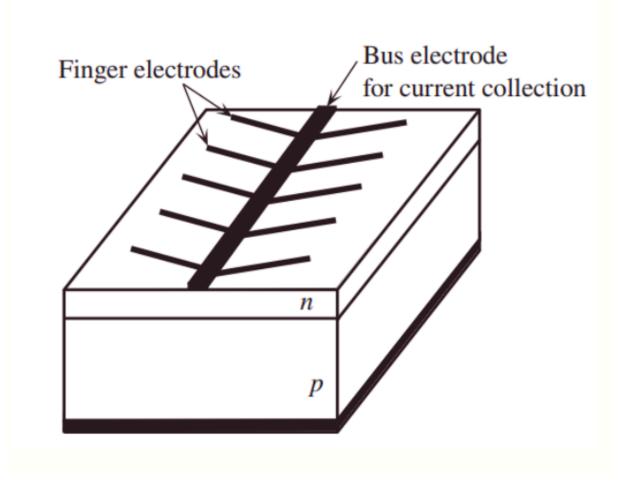


Figure 19: 指纹电极设计

### Antireflective Layer(抗反射涂层)

主要用于减少光的反射损失,提高光的透射,从而增加进入半导体的光量,提升光电转换效率。位于半导体材料和空气之间.

light transmitted to the semiconductor.

 To compute amount of reflectivity (R), the parameters below are defined:

n<sub>0</sub>, n<sub>1</sub>, and n<sub>2</sub> are refractive index

d<sub>1</sub>: thickness of n<sub>1</sub> (nm)

λ: wavelength of light (nm)

$$R = \frac{{r_1}^2 + {r_2}^2 + 2\pi\cos 2\theta^{\circ}}{1 + {r_1}^2{r_2}^2 + 2\pi\cos 2\theta^{\circ}}$$

 $r1 = \frac{n_0 - n_1}{n_0 + n_1}$   $r2 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$   $\theta = \frac{2\pi \cdot n_1 \cdot d_1}{\lambda}$ (need to convert to degree)

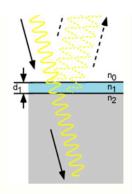


Figure 20: 反射光强占入射光强的比例

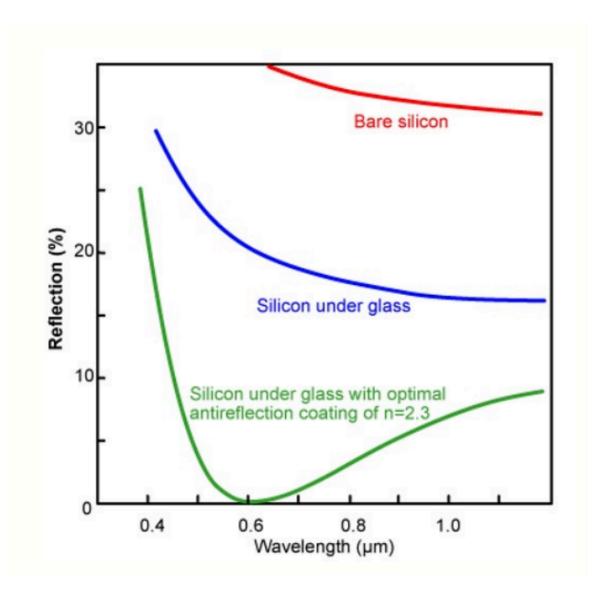


Figure 21: 0.6 微米是太阳光功率最大的波长,要设计为这个波长的反射率最低

小面积芯片产生的能量比较小,要提高表面积.光伏电池以串联和/或并联电路连接,以产生更高的电压、电流和功率水平,光伏组件由密封在环保层压板中的光伏电池电路组成,是光伏系统的基本组成部分.规模较小的称为 Panel, 较大的叫做 Array.

#### • 分类

- ► Monocrystalline Silicon Solar Cells(单晶硅太阳能电池片,更加高效 [包括空间占用高效],但是成本更高)
- ▶ Polycrystalline Silicon Solar Cells(多晶硅太阳电池)
- ▶ Thin-Film Solar Cells(薄膜太阳能电池,虽然薄,可以变形,但是效率 比晶体硅低)

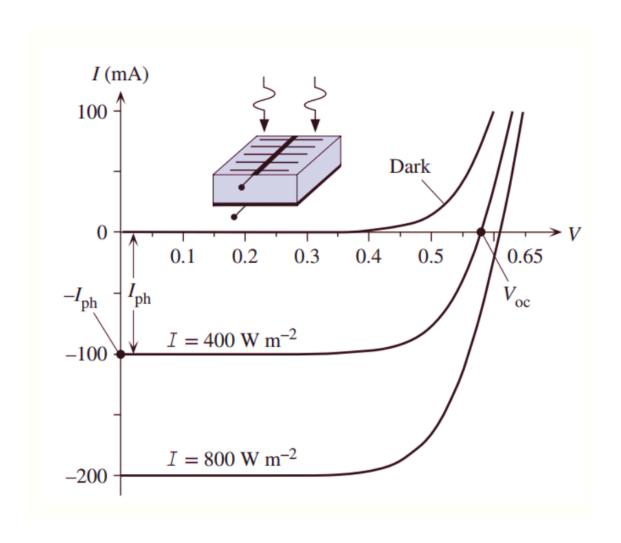


Figure 22: 在不同的光照条件下的 I-V 曲线,  $I_{\mathrm{ph}}$ :短路电流, $V_{\mathrm{oc}}$ :开路电压

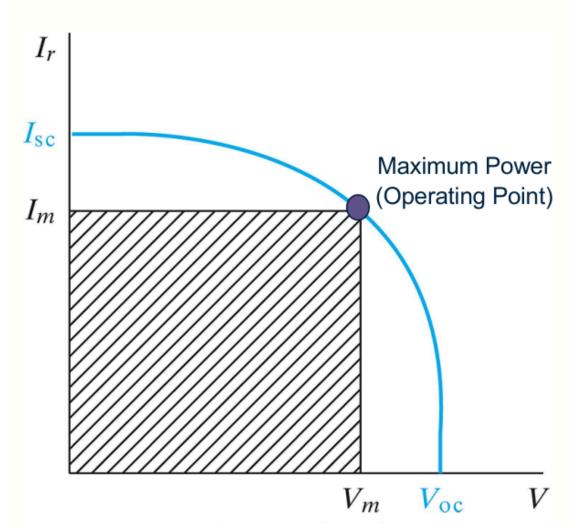


Figure 23: 换个方向画,可以找到功率最大的点

最大功率矩形面积占 $V_{
m oc}$ , $I_{
m sc}$ 面积叫做 fill factor FF

$$FF = \frac{I_m V_m}{I_{sc} V_{oc}}$$
 [12]

如果 I-V 曲线越接近矩形,就越理想,这个 FF 就是衡量这个的